## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-227352

(43)Date of publication of application: 24.08.1999

(51)Int.CI.

B41N 1/14

G03F 7/00

(21)Application number: 10-036191

(71)Applicant:

**TORAY IND INC** 

(22)Date of filing:

18.02.1998

(72)Inventor:

FUJIMARU KOICHI

ICHIKAWA SHIGEHIKO

IKEDA NORIMASA

## (54) DIRECT DRAWING TYPE WATERLESS LITHOGRAPHIC PRINTING BLOCK ORIGINAL PLATE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a direct drawing type waterless lithographic printing original plate of high sensitivity.

SOLUTION: In the direct drawing type waterless lithography formed of a base on a heat-sensitive layer and a silicone rubber layer laminated in the above order, a compound containing hydrazo and a light and heat conversion substance are contained in molecules constituting the heat-sensitive layer. The compound containing hydrazo is an acrylic resin, and a crosslinking component is contained in the heat-sensitive layer. The glass transition temperature Tg of the heat-sensitive layer is 50°C or lower.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

#### [Claim(s)]

[Claim 1] The straight-writing-type-water-less lithography version original edition characterized by containing the compound which has a hydrazo machine in the molecule of the compound which constitutes this sensible-heat layer on a substrate in the straight-writing-type-water-less lithography version original edition which comes to carry out the laminating of a sensible-heat layer and the silicone rubber layer one by one at least, and the light-and-heat conversion matter.

[Claim 2] The straight-writing-type-water-less lithography version original edition characterized by the compound which has a hydrazo machine according to claim 1 being an acrylic resin.

[Claim 3] The straight-writing-type-water-less lithography version original edition according to claim 1 to 2 characterized by a sensible-heat layer containing a cross-linking-agent component further.

[Claim 4] The straight-writing-type-water-less lithography version original edition according to claim 1 to 3 characterized by the glass transition temperature Tg of a sensible-heat layer being 50 degrees C or less.

[Translation done.]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

## 特開平11-227352

(43)公開日 平成11年(1999)8月24日

| (51) Int.CL.6 |      | 識別記号 | ΡI   |      |     |
|---------------|------|------|------|------|-----|
| B41N          | 1/14 |      | B41N | 1/14 |     |
| G03F          | 7/00 | 504  | G03F | 7/00 | 504 |

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 20 頁)

| (21)出顧番号 | 特顧平10-36191       | (71)出願人 000003159          |
|----------|-------------------|----------------------------|
|          |                   | 東レ株式会社                     |
| (22)出顧日  | 平成10年(1998) 2月18日 | 東京都中央区日本橋室町2丁目2番15         |
|          |                   | (72)発明者 藤丸 浩一              |
|          |                   | <b>滋賀</b> 県大津市園山1丁目1番1号 東1 |
|          |                   | 式会社遊貨事業場内                  |
|          |                   | (72)発明者 市川 成彦              |
|          |                   | 进賀県大津市岡山1丁目1番1号 東日         |
|          |                   | 式会社滋賀事業場内                  |
|          |                   | (72)発明者 池田 憲正              |
|          |                   | 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東1         |
|          |                   | 式会社滋賀事業場内                  |

## (54) 【発明の名称】 直描型水なし平版印刷版原版

## (57)【要約】

【課題】高感度の直描型水なし平版印刷版を得る。 【解決手段】基板上に少なくとも感熱層、シリコーンゴム層をこの順に積層してなる直描型水なし平版において、該感熱層を構成する化合物の分子内にヒドラゾ基を有する化合物と光熱変換物質を含有することを特徴とする直描型水なし平版印刷版原版。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に、少なくとも感熱層およびシリコ ーンゴム層を順次積層してなる直描型水なし平版印刷版 原版において、該感熱層を構成する化合物の分子内にヒ ドラゾ基を有する化合物と光熱変換物質を含有すること を特徴とする直描型水なし平版印刷版原版。

【請求項2】請求項1に記載のヒドラゾ基を有する化合 物がアクリル系樹脂であることを特徴とする直描型水な し平版印刷版原版。

【請求項3】感熱層がさらに架橋剤成分を含有すること 10 を特徴とする請求項1~2のいずれかに記載の直描型水 なし平版印刷版原版。

【請求項4】感熱層のガラス転移温度Tgが50℃以下 であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載 の直描型水なし平版印刷版原版。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は湿し水を用いること なしに印刷が可能である水なし平版印刷版原版に関する なし平版印刷版原版に関するものである。

[0002]

【従来の技術】製版用フィルムを使用しないで、原稿か ら直接オフセット印刷版を作製する、いわゆるダイレク ト製版は、熱棟度を必要としない簡易性、短時間で印刷 版が得られる迅速性、多様なシステムから品質とコスト に応じて選択可能である合理性などの特徴を生かして、 軽印刷業界のみでなく、一般オフセット印刷、グラビア 印刷の分野にも進出し始めている。

【0003】特に最近では、プリプレスシステムやイメ 30 ージセッター、レーザープリンターなどの出力システム の急激な進歩によって新しいタイプの各種平版印刷材料 が開発されている。

【0004】これらの平版印刷版を、製版方法から分類 すると、レーザー光を照射する方法、サーマルヘッドで 書き込む方法、ピン電極で電圧を部分的に印加する方 法、インクジェットでインキ反発層またはインキ着肉層 を形成する方法などが挙げられる。 なかでも、レーザ 一光を用いる方法は解像度、および製版速度の面で他の 方式よりも優れており、その種類も多い。

【0005】このレーザー光を用いる平版印刷版はさら に、光反応によるフォトンモードタイプのものと、光熱 変換を行って熱反応を起こさせるヒートモードタイプの 2つに分けられる。

【0006】フォトンモードタイプとしては

- (1)フォトポリマーを用いた高感度PS版
- (2) 有機光導電体や酸化亜鉛を用いた電子写真式平版
- (3)銀塩方式平版
- (4)銀塩複合方式平版
- (5) 直描マスター

などがあり、ヒートモードタイプとしては

(6)熱破壞方式平版

が挙げられる。

【0007】しかしながら、(1)の方式はレーザー光 源に主としてアルゴンイオンレーザーを使用しているた め装置が大型となり、また印刷版も高感度のフォトポリ マーを使用しているため、印刷版の取り扱いに注意が必 要で、なおかつ保存安定性も低下しやすいといった欠点 がある。

2

【0008】(2)の電子写真式平版は、明室で取り扱 えるといった利点はあるが、感光層の帯電後2~5分の 間で暗減衰が大きくなるため、帯電後短時間で露光現像 処置をする必要があり、大判サイズを高解像力で出力す るのは難しい。

【0009】(3)の銀塩方式は、様々な波長のレーザ 一に対応した印刷版が開発されているが、銀廃液が出る ことが問題となっており、また感度が高いために、取り 扱いに注意を要するといった問題もある。

【0010】(4)の銀塩複合方式平版は、感光層上に ものであり、特にレーザー光で直接製版できる直描型水 20 高感度のハロゲン化銀乳剤層をアルゴンイオンレーザー で露光、現像後それをマスクとしてさらに紫外線で露 光、現像を行うものである。しかし、この印刷版は露 光、現像工程が2回あるため、印刷版の処理が複雑にな るという問題がある。

> 【0011】(5)の直描マスターは、直接印刷版にレ ーザーで書き込むわけではないが、レーザープリンター で形成されたトナー画像をインキ着肉部として、印刷版 上に転写するものである。しかし、印刷版の解像度とい う面では、他の方式と比較して劣っている。

【0012】以上のフォトンモードタイプに対して、 (6)の熱破壊方式は、明室で取り扱えるというといっ た利点があり、また光源となる半導体レーザーの出力の 急激な進歩によって、最近その有用性が見直されてきて いる。

【0013】例えば、USP5379698号明細書に は、金属薄膜を感熱層として用いる直描型水なし平版印 刷版が記載されているが、金属薄膜自体がレーザー光が 透過するために、印刷版の感度が悪いという問題があっ た。このため、レーザー光の吸収率を上げるためには、

40 反射防止層を設けなければならず、塗布工程がさらに増 えて、コストがかかる結果となる。

【0014】また、特開平9-146264号公報、特 開平6-199064号公報、USP5339737号 公報、EP0580393号公報、特開平6-5572 3号公報、EP0573091号公報、USP5378 580号公報、特開平7-164773号公報、USP 5333705号公報、EP0644647号公報に も、にもレーザー光を光源として用いる、直描型水なし 平阪印刷版原版が記載されている。

50 【0015】この熱破壊方式の印刷版原版の感熱層は、

る.

例えばレーザー光吸収化合物としてカーボンブラックを 用い、熱分解化合物としてニトロセルロースを使用して おり、その表面にシリコーン層が塗布されている。感熱 層中のカーボンブラックがレーザー光を吸収し熱エネル ギーに変換され、さらにその熱で感熱層が破壊される。 そして、最終的にこの部分を除去することによって、イ ンキを着肉しないシリコーンゴム層が同時に剥離され、 インキの着肉する画線部となる。

【0016】しかしながら、ニトロセルロースは燃焼性 が高く、レーザー照射部以外の感熱層部分にまで感熱層 10 を以下に示す。 の破壊が及びやすく、画線部/非画線部の境界が明確で なく、現像後の網点形状が悪くなる問題。これに由来す る印刷時の問題を有している。

【0017】前記問題はレーザーの照射強度を小さくし たり、感熱層組成の最適化を行う、すなわちニトロセル ロースの燃焼性を抑えることで回避できる場合がある が、感度が低下する問題があった。

#### [0018]

【発明が解決しようとする課題】本発明では、ニトロセ ルロース化合物を感熱層中に含有する版と比較し、画線 20 部/非画線部のエッジがシャープで、感度が向上した直 描型水なし平阪印刷阪原版を提供することにある。

#### [0019]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明は下記の構成からなる。

【0020】(1)基板上に、少なくとも感熱層および シリコーンゴム層を順次積層してなる直描型水なし平版 印刷販原版において、該感熱層を構成する化合物の分子 内にヒドラゾ基を有する化合物と光熱変換物質を含有す ることを特徴とする直描型水なし平版印刷版原版。 [0021]

【発明の実施の形態】本発明において、直描型とは、露 光時にネガあるいはポジのフィルムを用いずに、印刷版 上に直接記録ヘッドから、画像形成を行うことをいう。 【0022】次に、本発明の直描型水なし平版印刷版に ついて説明する。

【0023】本発明で使用される感熱層は、レーザー光 を吸収した部分の上層のシリコーンゴム層との接着力が 低下することが重要である。

【0024】従来の感熱層は、硝酸アンモニウム、硝酸 40 カリウム、硝酸ナトリウム、ニトロセルロースなどのニ トロ化合物が用いられてきたが、本発明ではニトロ化合 物を用いず、ヒドラジン誘導体をを用いる。ヒドラゾ基 のN-N結合の結合解離エネルギーは共有結合の中でも 際だって低く、レーザー照射による熱でヒドラゾ結合は 容易に切断される。ヒドラゾ基を感熱層中に含有させる ことによって、ニトロセルロースを含有する版の感熱層 が破壊されないような低エネルギーのレーザー光で、感 熱層で爆発、燃焼、分解、気化等の反応が起きる。これ

【0025】本発明でいうヒドラゾ基を有する化合物 は、ヒドラジンおよびその誘導体と反応する化合物によ り得ることができる。反応性基を有する化合物として、 例えば、カルボキシル基、水酸基、アミノ基、メルカプ ト基などの活性水素を有する化合物、エポキシ基、カル ボニル基、アルデヒド基、イソシアネート基を有する化 合物などが挙げられる。

4

【0026】本発明でいうヒドラジンおよびその誘導体

【0027】(1)ヒドラジン

ヒドラジン、モノメチルヒドラジン、ジメチルヒドラジ

【0028】(2)アルキル (アリール) ヒドラジン類 メチル基やエチル基などのアルキル基で置換したモノ ジー置換体のアルキルヒドラジン、フェニル基、p -ニトロフェニル基、2,4-ジニトロフェニル基など のアリール基で置換したモノー、ジー置換体のアリール ヒドラジン。

【0029】(3)ヒドロキシアルキル(アリール)ヒ ドラジン類

ヒドラジンあるいは前記アルキルヒドラジン、アリール ヒドラジンとエポキシとの反応により得られる、ヒドロ キシアルキル (アリール) ヒドラジン類。 ヒドラジンあ るいは前記アルキルヒドラジン、アリールヒドラジンと グリシジルメタクリレートなどのようなエチレン性二重 結合基を有するエポキシ基含有化合物、脂肪族、脂環族 エポキシ基含有化合物との反応によって得られるエチレ ン性二重結合基含有ヒドロキシアルキルヒドラジンおよ 30 びエチレン性二重結合基含有ヒドロキシアリールヒドラ

【0030】(4)ヒドラゾン、アジン類 上記アルキルヒドラジン、アリールヒドラジンとホルム アルデヒド、グリオキサールのようなアルデヒド化合 物、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチル ケトンのようなカルボニル化合物との縮合反応によって 得られるヒドラゾン、アジン類。

#### 【0031】(5)ヒドラジド類

カルボン酸の水酸基をヒドラジノ基で置換したカルボン 酸ヒドラジド。アクリル酸ヒドラジド、メタクリル酸ヒ ドラジド、プロピオン酸ヒドラジド、アジピン酸ヒドラ ジド、アジピン酸ジヒドラジド、マレイン酸ヒドラジ ド、マレイン酸ジヒドラジド、テレフタル酸ヒドラジ ド、テレフタル酸ジヒドラジド、アセトンジカルボン酸 ヒドラジド、アセトンジカルボン酸ジヒドラジド、セミ カルバジド、セミカルバゾンなどが挙げられる。他にチ オヒドラジド、スルホニルヒドラジド、カルバゼート、 チオセミカルバジド、カルボヒドラジド、チオカルボヒ ドラジド、リン酸ヒドラジド、リン酸ジヒドラジド、チ により、感熱層とシリコーンゴム層との接着性が低下す 50 オホスホニルトリヒドラジドなどが挙げられる。これら

の中でもヒドラジン、ヒドロキシアリールヒドラジン 類、ヒドラジド類が好ましく用いられる。これらヒドラ ジンおよびヒドラジン誘導体はそれぞれ単独でも使用で きるし、2種以上を混合して使用することもできる。

【0032】前述(1)~(5)のヒドラジンおよびそ の誘導体は、カルボキシル基、水酸基、アミノ基、メル カプト基などの活性水素を有する化合物、エポキシ基、 カルボニル基、イソシアネート基を有する化合物などと の共重合、縮合、付加およびグラフト重合、もしくは官 能基にペンダントとして結合させて使用されることが好 10 ましく、これにより主鎮および/または側鎖にヒドラゾ 基を有する化合物を得ることができる。このような化合 物としてはアクリル系樹脂が使用される。

【0033】以下にヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂 について詳細に示す。

【0034】ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂として は、例えば、(メタ)アクリル酸等の一塩基性カルボン 酸あるいはそのエステルと、前述(1) $\sim$ (5)のヒド ラジンおよび誘導体、これらと共重合し得る少なくとも 一種の化合物と公知の方法を利用して重合させることに 20 より得られるヒドラゾ基を有する化合物、またカルボキ シル基を有するアクリル樹脂に前述(1)~(5)のヒ ドラジンおよび誘導体、を反応させることにより得るこ とができる。

【0035】この際に使用するカルボン酸あるいはその エステルの例としては、(メタ)アクリル酸、(メタ) アクリル酸メチルエステル、(メタ) アクリル酸エチル エステル、(メタ) アクリル酸イソプロピルエステル、 (メタ) アクリル酸プチルエステル、(メタ) アクリル 酸イソブチルエステル、(メタ)アクリル酸アミルエス 30 テル、(メタ) アクリル酸ヘキシルエステル、(メタ) アクリル酸オクチルエステル、(メタ)アクリル酸-2 -エチルヘキシルエステル、(メタ) アクリル酸デシル エステル、(メタ) アクリル酸ドデシルエステル、(メ タ) アクリル酸ヒドロキシメチルエステル、(メタ) ア クリル酸ヒドロキシエチルエステルを挙げることができ る。また、上記のカルボン酸あるいはそのエステルと共 重合し得る化合物の例としては、エチレン、酢酸ビニ ル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、無水マレイン酸、無 チレン、アクリロニトリル、ビニルトルエン、N-メチ ロール (メタ) アクリルアミド、N-ブトキシメチル (メタ) アクリルアミド、ビニルヒリジンおよびNービ ニルピロリドンを挙げることができる。また、鍵盤性を 付与するためにハロゲン等で変性されていてもよい。こ れらは単独であるいは2種以上併用して用いることがで きる。

【0036】これらヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂 は、単独で使用してもよいし、2種以上併用してもよ 61.

【0037】以上のようなヒドラゾ基を有する樹脂のヒ ドラゾ基含有量は、化合物1分子中にヒドラゾ基を2個 以上有していることが好ましい。ヒドラゾ基が2個以下 の場合は、印刷版の感度が低下する。

【0038】また、分子量としては300~50万が好 ましく、より好ましくは400~20万である。

【0039】また、感熱層中のヒドラゾ基を有する化合 物は10~95重量%が好ましく、より好ましくは20 ~80重量%である。

【0040】さらに、感熱層は形態保持性の向上、溶剤 耐性の向上、上層のシリコーンゴム層との接着性の向上 を目的とし、架橋剤を含有することが好ましい。架橋剤 は、ヒドラゾ基を有する化合物と反応させてもよいし、 ヒドラジド基を有していない他のポリマー、オリゴマー を感熱層に含有させた場合、その化合物と反応させても よいし、両者ともに反応させてもよい。

【0041】このような架橋剤としては、架橋剤ハンド ブック(1981年、大成社出版、山下普三・金子東助 著) に記載されているようなものがいずれも使用でき る。これら架橋剤の選択は被架橋体によって好ましく選 択される。本発明では、イソシアネート系、エポキシ 系、アルデヒド系の架橋剤が好ましく使用される。

【0042】感熱層中の架橋剤は、0~30重量%で使 用される。

【0043】また、前述したヒドラジンおよび誘導体以 外に他のポリマー、オリゴマーを感熱層に含有させても よい。

【0044】 このようなポリマー、オリゴマーの例とし て、カルナバワックス、木ロウ、オウリキュリーロウお よびエスパルロウ等の植物ロウ、蜜ロウ、昆虫ロウ、セ ラミックロウおよび鯨ロウ等の動物ロウ、パルミチン酸 セチル、パルミチン酸ミリシル、ステアリン酸セチルお よびステアリン酸ミリシル等の合成エステルワックス、 パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、 ポリエチレンワックス、エステルワックスおよび酸化ワ ックスなどの石油ロウ、モルタンロウ、オゾケライトお よびセレシン等の鉱物ロウ等のワックス類、パルミチン 酸、ステアリン酸、マルガリン酸およびベヘン酸等の高 級脂肪酸、パルミチルアルコール、ステアリルアルコー 水フマル酸、スチレン、2-メチルスチレン、クロルス 40 ル、ベヘールアルコール、マルガニルアルコール、ミリ シルアルコールおよびエイコサノール等の高級アルコー ル、アセトアミド、プロピオン酸アミド、パルミチン酸 アミド、ステアリン酸アミドおよびアミドワックス等の アミド類、ならびに、ステアリルアミン、ベヘニルアミ ンおよびパルミチルアミン等の高級アミン類、エチレン 一酢酸ビニル共重合体、エチレン- (メタ) アクリル酸 共重合体、エチレンー (メタ) アクリル酸メチル共重合 体、エチレンー (メタ) アクリル酸エチル共重合体、エ チレンー(メタ)アクリル酸イソブチル共重合体、エチ 50 レンー塩化ビニル共重合体、エチレンー(メタ)アクリ

ル酸金属塩共重合体等のエチレン共重合体、ポリアミド 系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ オレフィン樹脂、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、 セルロース系樹脂、ロジン樹脂、アイオノマー樹脂およ び石油系樹脂等の樹脂類、ジエン系コポリマー、天然ゴ ム、スチレンブタジエンゴム、イソプレンゴムおよびク ロロプレン等のエラストマー類、エステルガム、ロジン マレイン酸樹脂、ロジンフェノール樹脂および水添ロジ ン等のロジン誘導体、フェノール樹脂、テルペン樹脂、 シクロペンタジエン樹脂および芳香族系炭化水素樹脂等 10 の化合物を挙げることができる。これらは単独で用いて もよいし、併用してもよい。

【0045】これらのバインダーの含有量は、感熱層に 対して0~90重量%が好ましい。90重量%よりも多 いと版の感度が低下しやすい。

【0046】また、シリコーンゴム層と感熱層の接着を 発現させるために、感熱層中にシリコーンゴム接着反応 成分と反応しうる化合物、官能基を含有させる必要があ る。

【0047】この場合、感熱層中にヒドラゾ基と水酸基 20 含有化合物および不飽和二重結合基とがそれぞれ独立に 存在しているのではなく、ヒドラジン化合物がシリコー ンゴム層接着成分と反応しうる官能基を含有している方 がレーザー照射部分のシリコーンゴム層の剥離、脱落、 除去の効果が高くなりやすく、より好ましい。例えば、 上層のシリコーンゴム層が付加型シリコーンの場合、感 熱層にエチレン性二重結合基、水酸基などを分子末端、 グラフト化、ペンダント化された、ヒドラゾ基を有する 化合物を用いる。また、縮合型シリコーンの場合、感熱 された、ヒドラゾ基を有する化合物を用いることで達成 される。

【0048】上記の他に感熱層の硬化およびシリコーン ゴム層との接着性の向上の点から、感熱層中に、重合可 能なエチレン性二重結合を有する基を熱、光ラジカル発 生剤を用い、シリコーンゴム層を塗設後、加熱あるいは 光照射により重合反応を進行させても良い。上記の他に 添加できる化合物を以下に示す。中でもエポキシアクリ レート類が特に好ましい。エチレン性不飽和二重結合を 有する化合物の使用量は、感熱層に対して0~30重量 40 シプロピレンジアミン、ノナオキシプロピレンジアミ

【0049】(1)多官能水酸基含有化合物とアクリル 酸、メタクリル酸のエステル化物

多官能水酸基含有化合物としては、エチレングリコー ル、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、 プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリ プロピレングリコール、1,3-ブタンジオール、1, 6-ヘキサンジオール、1,8-オクタンジオール、 1,9-ノナンジオール、ヒドロキノン、ジヒドロキシ アントラキノン、ピスフェノールA、ピスフェノール

S、レゾール樹脂、ピロガロールアセトン樹脂、ヒドロ キシスチレンの共重合体、グリセリン、ペンタエリスリ トール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロ パン、ポリピニルアルコール、セルロース、およびその 誘導体、ヒドロキシアクリレート、ヒドロキシメタクリ レートの重合体および共重合体が挙げられる。これらの 多官能水酸基含有化合物とアクリル酸、メタクリル酸は 公知の方法によりエステル化反応させることにより目的 とする化合物を得ることができる。この際、1分子中に 2個以上エチレン性不飽和基を含有する比率で反応させ ることが必要である。

Я

【0050】(2)エポキシ化合物とアクリル酸、メタ クリル酸あるいはグリシジルアクリレート、グリシジル メタクリレートを反応させたエポキシアクリレート類。 【0051】エポキシ化合物の具体例としては(1)項 で記載した水酸基含有化合物にエピハロヒドリンを反応 させることにより得られる化合物が挙げられる。

【0052】また、上記の水酸基含有化合物の水酸基の それぞれにエチレンオキサイドやプロピレンオキサイド を付加したものも同様に使用することができる。

【0053】これらのエポキシ化合物とアクリル酸、メ タクリル酸あるいはグリシジルアクリレート、グリシジ ルメタクリルレートを公知の方法で反応させることによ り目的とするエポキシアクリレート類を得ることができ

【0054】(3)アミン化合物とグリシジルアクリレ ート、グリシジルメタクリレートあるいはアクリル酸ク ロライド、メタクリル酸クロライドを反応させたもの。 【0055】アミン化合物としては、オクチルアミン、 層に水酸基などを分子末端、グラフト化、ペンダント化 30 ラウリルアミン等の1個のアミン化合物、ジオキシエチ レンジアミン、トリオキシエチレンジアミン、テトラオ キシエチレンジアミン、ペンタオキシエチレンジアミ ン、ヘキサオキシエチレンジアミン、ヘプタオキシエチ レンジアミン、オクタオキシエチレンジアミン、ノナオ キシエチレンジアミン、モノオキシプロピレンジアミ ン、ジオキシプロピレンジアミン、トリオキシプロピレ ンジアミン、テトラオキシプロピレンジアミン、ペンタ オキシプロピレンジアミン、ヘキサオキシプロピレンジ アミン、ヘプタオキシプロピレンジアミン、オキタオキ ン、ポリメチレンジアミン、ポリエーテルジアミン、ジ エチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラ エチルペンタミン、等の脂肪族ポリアミン化合物や、m ーキシリレンジアミン、pーキシリレンジアミン、mー フェニレンジアミン、ジアミノジフェニルエーテル、ベ ンジジン、4,4'-ピス(o-トルイジン)、4, 4' -チオジアニリン、o-フェニレンジアミン、ジア ニシジン、4ークロロー0ーフェニレンジアミン、4ー メトキシー6ーメチルーmーフェニレンジアミン等のポ 50 リアミン化合物が挙げられる。これらのアミン化合物と

グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレートあ るいはアクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライド を公知の方法により反応さることにより目的とする化合 物を得ることができる。

【0056】(4)カルボキシル基を有する化合物とグ リシジルアクリレート、グリシジルメタクリレートを反 応させたもの。

【0057】カルボキシル基含有化合物としては、マロ ン酸、コハク酸、リンゴ酸、チオリンゴ酸、ラセミ酸、 クエン酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スペ 10 ロシアニン系の緑色顔料、カーボングラファイト、鉄 リン酸、アゼライン酸、セバシン酸、マレイン酸、フマ ール酸、イタコン酸、ダイマー酸、トリメリット酸、未 加硫ゴムのカルボキシ変性物等が挙げられる。

【0058】これらカルボキシル基を有する化合物は公 知の方法によりグリシジルアクリレート、グリシジルメ タクリレートと反応させて目的とする化合物を得ること ができる。

【0059】(5)ウレタンアクリレート類 グリセリンジアクリレートイソホロンジイソシアネート ウレタンプレポリマー、ペンタエリスリトールトリアク 20 リレートヘキサメチレンジイソシアネートウレタンプレ ポリマー等が挙げられる。

【0060】上記の1分子中にエチレン性不飽和二重結 合を2個以上有する化合物はそれぞれ単独でも使用でき るし、2種以上を混合して使用することもできる。

【0061】熱により重合を行う場合には、過酸化アセ チル、過酸化クミル、過酸化tert-ブチル、過酸化 ベンゾイル、過酸化ラウロイル、過硫酸カリウム、ベル オキシ炭酸ジイソプロピル、テトラリンヒドロペルオキ ertーブチル、過安息香酸tertーブチルなどの過 酸化物、2,2'-アゾビスプロパン、1,1'-アゾ (メチルエチル) ジアセテート、2,2'-アゾビスイ ソブチルアミド、2,2'-アゾピスイソブチロニトリ ルなどのアゾ化合物やベンゼンスルホニルアジド、1, 4-ビス (ペンタメチレン) -2-テトラゼンなどが、 ラジカル発生剤として用いられる。

【0062】光により重合を行う場合には、ジエトキシ アセトフェノン、ベンジルジメチルケタール、1-ヒド ロキシシクロヘキシルーフェニルケトンなどのアセトフ 40 ェノン系化合物、ベンゾイン、ベンゾインエチルエーテ ル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソ ブチルエーテルなどのベンゾイン系化合物、ベンゾフェ ノン、o-ベンゾイル安息香酸メチル、4-ベンゾイル -4'ーメチルージフェニルサルファイドなどのベンゾ フェノン系化合物、2-イソプロピルチオキサントン、 2, 4-ジェチルチオキサントン、2, 4-ジクロロチ オキサントンなどのチオキサントン系化合物、トリエタ ノールアミン、トリイソプロパノールアミン、4ージメ チルアミノ安息香酸エチル、4,4'-ビスジエチルア 50 料、アゾ系分散染料、ベンゾチオピラン系スピロビラ

10

ミノベンゾフェノン、4,4'ービスジメチルアミノベ ンゾフェノン(ミヒラーケトン)などのアミン系化合物 や、ベンジル、カンファーキノン、2-エチルアンスラ キノン、9、10ーフェナンスレンキノンなどがラジカ ル発生剤として用いられる。

【0063】光熱変換物質としては、光を吸収して熱に 変換しうる物質であれば、特に限定されるものではな く、例えばカーボンブラック、アニリンブラック、シア ニンブラックなどの黒色顔料、フタロシアニン、ナフタ 粉、ジアミン系金属錯体、ジチオール系金属錯体、フェ ノールチオール系金属錯体、メルカプトフェノール系金 属錯体、アリールアルミニウム金属塩類、結晶水含有無 機化合物、硫酸銅、硫化クロム、珪酸塩化合物や、酸化 チタン、酸化バナジウム、酸化マンガン、酸化鉄、酸化 コバルト、酸化タングステンなどの金属酸化物、これら の金属の水酸化物、硫酸塩、さらにビスマス、スズ、テ ルル、鉄、アルミの金属粉などの添加剤を添加すること が好ましい。

【0064】これらのなかでも、光熱変換率、経済性お よび取り扱い性の面から、カーボンブラックが好まし 41

【0065】また上記の物質以外に、赤外線または近赤 外線を吸収する染料も、光熱変換物質として好ましく使 用される。

【0066】これら染料としては400nm~1200 nmの範囲に極大吸収波長を有する全ての染料が使用で きるが、好ましい染料としては、シアニン系、フタロシ アニン系、フタロシアニン金属錯体系、ナフタロシアニ シド、tert-ブチルヒドロペルオキシド、過酢酸t 30 ン系、ナフタロシアニン金属錯体系、ジチオール金属錯 体系、ナフトキノン系、アントラキノン系、インドフェ ノール系、インドアニリン系、ピリリウム系およびチオ ピリリウム系、スクワリリウム系、クロコニウム系、ジ フェニルメタン系、トリフェニルメタン系、トリフェニ ルメタンフタリド系、トリアリルメタン系、フェノチア ジン系、フェノキサジン系、フルオラン系、チオフルオ ラン系、キサンテン系、インドリルフタリド系、スピロ ピラン系、アザフタリド系、クロメノピラゾール系、ロ イコオーラミン系、ローダミンラクタム系、キナゾリン 系、ジアザキサンテン系、ビスラクトン系、フルオレノ ン系、モノアゾ系、ケトンイミン系、ジズアゾ系、メチ ン系、オキサジン系、ニグロシン系、ビスアゾ系、ビス アゾスチルベン系、ビスアゾオキサジアゾール系、ビス アゾフルオレノン系、ビスアゾヒドロキシペリノン系、 アゾクロム錯塩系、トリスアゾトリフェニルアミン系、 チオインジゴ系、ペリレン系、ニトロソ系、1:2型金 属錯塩系、分子間型CT系、キノリン系、キノフタロン 系、フルキド系の酸性染料、塩基性染料、色素、油溶性 染料や、トリフェニルメタン系ロイコ色素、カチオン染

ン、3、9-ジブロモアントアントロン、インダンスロ ン、フェノールフタレイン、スルホフタレイン、エチル パイオレット、メチルオレンジ、フルオレッセイン、メ チルビオロゲン、メチレンブルー、ジムロスベタインな どが挙げられる。

【0067】これらのなかでも、エレクトロニクス用や 記録用の色素で、最大吸収波長が700 nm~900 n mの範囲にある、シアニン系色素、アズレニウム系色 素、スクアリリウム系色素、クロコニウム系色素、アゾ 系色素、アントラキノン系色素、ペリレン系色素、フタ ロシアニン系色素、ナフタロシアニン金属錯体系色素、 ジチオールニッケル錯体系色素、インドアニリン金属錯 体色素、分子間型CT色素、ベンゾチオピラン系スピロ ピラン、ニグロシン染料などの黒色染料が好ましく使用 される。

【0068】さらにこれらの染料のなかでも、モル吸光 度係数の大きなものが好ましく使用される。具体的には  $\varepsilon = 1 \times 10^4$ 以上が好ましく、より好ましくは $1 \times 1$  $0^5$ 以上である。 $\epsilon$ が $1 \times 10^4$ より小さいと、感度の向 20 上効果が発現しにくいためである。

【0069】これらの光熱変換物質は単独でも感度の向 上効果はあるが、2種以上を併用して用いることによっ て、さらに感度を向上させることも可能である。

【0070】これらの光熱変換物質の含有量は、全感熱 層組成物に対して2~70重量%が好ましく、より好ま しくは5~60重量%である。2重量%よりも少ない場 合には感度の向上効果が見られず、70重量%よりも多 い場合には印刷版の耐刷性が低下しやすい。

【0071】さらに前記感熱層には、防腐剤、ハレーシ 30 ョン防止染料、消泡剤、帯電防止剤、分散剤、乳化剤、 界面活性剤などの添加剤を適宜含有させても良い。

【0072】特に塗工性を向上させるために、フッ素系 界面活性剤を添加することは好ましい。これらの添加剤 の含有量は、通常全感熱層組成物に対して10重量%以

【0073】さらに場合によっては、上層の付加型シリ コーンゴム層との接着性を向上させるために、シリカ粉 末や、表面を (メタ) アクリロイル基やアリル基含有シ 感熱層組成物に対して20重量%以下の量で添加しても 良い。

【0074】上記の感熱層を形成するための組成物は、 ジメチルホルムアミド、メチルエチルケトン、メチルイ ソブチルケトン、ジオキサン、トルエン、キシレン、酢 酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、酢酸イソアミ ル、プロピオン酸メチル、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エ チレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコ ールジエチルエーテル、アセトン、メタノール、エタノ 50 単独あるいは二種以上混合して用いることができる。

ール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、ジア セトンアルコール、ペンジルアルコール、酪酸ブチル、 乳酸エチルなどの適当な有機溶剤に溶解させることによ って組成物溶液として調製される。かかる組成物溶液を 基板上に均一に塗布し必要な温度で必要な時間乾燥する ことにより、感熱層が形成される。これらの乾燥温度は 熱分解性化合物であるヒドラジン化合物が分解しない範 囲で行う必要がある。

【0075】感熱層の膜厚は0.1g/m²から10g 系分散色素、ビスアゾスチルベン系色素、ナフトキノン 10 /m²が好ましく、より好ましくは0.2g/m²から5  $g/m^2$ である。膜厚が $0.1g/m^2$ よりも薄い場合は 耐刷性が低下し易く、また10g/m²よりも厚いと、 経済的に不利である。

> 【0076】また、感熱層は塗膜形成性の点からガラス 転移温度は50℃以下が好ましい。

【0077】この印刷版の基板としては、寸法的に安定 な板状物が用いられる。このような寸法的に安定な板状 物としては、従来印刷版の基板として使用されたものが 含まれ、それらを好適に使用することが出来る。かかる 基板としては、紙、プラスチック(例えばポリエチレ ン、ポリプロピレン、ポリスチレンなど)、亜鉛、銅な どのような金属板、例えばセルロース、カルボキシメチ ルセルロース、セルロースアセテート、ポリエチレン、 ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリスチレ ン、ポリプロピレン、ポリカーボネイト、ポリビニルア セテートなどのようなプラスチックフィルム、上記の如 き金属がラミネートもしくは蒸着された紙もしくはプラ スチックフィルムなどが含まれる。これらの基板のう ち、アルミニウム板は寸法安定性に優れており、しかも 安価であるので特に好ましい。また、軽印刷用の基板と して用いられている、ポリエチレンテレフタレートフィ ルムも好ましく使用される。

【0078】本発明で使用する直描型水なし平版印刷版 は、基板と感熱層との接着を強固にするため、プライマ **一層を用いても良い。本発明で使用する直描型水なし平** 版印刷版原版のプライマー層は、次の条件を満たすこと が必要である。すなわち、基板と感熱層とを良く接着 し、経時において安定であること、さらに現像液の溶剤 に対する耐性がよいことである。このような条件を満た ランカップリング剤で処理した疎水性シリカ粉末を、全 40 すものとして、特公昭61-54219号公報に示され るようなエポキシ樹脂を含むものの他、ポリウレタン樹 脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、ア ルキッド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、メ ラニン樹脂、尿素樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、塩化ビ ニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール樹 脂、ポリアクリロニトリルーブタジエン共重合体、レゾ ール樹脂、ポリエーテル樹脂、エポキシフェノール尿素 樹脂、ポリエーテルスルフォン樹脂、ミルクガゼイン、 ゼラチンなどを使用することができる。これらの樹脂は 【0079】また感熱層と類似の組成物を光または熱硬化したものを使用しても良い。

【0080】これらのなかでは、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、尿素樹脂、エポキシフェノール尿素樹脂、レゾール樹脂などを単独で、あるいは二種以上混合して用いることが好ましい。

【0081】これらのポリマーの含有量は全プライマー 層の組成物に対して、20~98重量%が好ましく、よ り好ましくは40~95重量%である。

【0082】また、プライマー層中には溶剤耐性を付与するために架橋剤を含有させることが好ましい。

【0083】架橋剤としては、上記の樹脂、例えばエポキシ樹脂とアミノ樹脂(尿素樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂など)の組み合わせでも可能であるが、それ以上にイソシアネート化合物と水酸基含有化合物に組み合わせも可能である。

【0084】そのようなイソシアネート化合物としては、例えばパラフェニレンジイソシアまた、イソシアネート化合物をメチルエチルケトオキシム、フェノール、 εーカプロラクタムなどでブロックしたブロックドイソ シアネートも同様に使用できる。

【0085】これらのイソシアネート化合物と反応できる、水酸基を有する化合物としては例えばエポキシ樹脂、フェノール樹脂、レゾール樹脂、水酸基含有ポリウレタン、アクリル樹脂、水酸基含有モノマーまたはオリゴマーが挙げられる。

【0086】これらの架橋剤の含有量は全プライマー層 組成物に対して20~70重量%が好ましく、より好ま しくは30~60重量%である。

【0087】さらにこれらの反応を促進する触媒として 酸や有機スズ化合物などを添加したり、塗工性を改良す る目的で、界面活性剤を添加することも任意である。

【0088】上記のプライマー層を形成するための組成物は、ジメチルホルムアミド、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジオキサンなどの適当な有機溶剤に溶解させることによって組成物溶液として調達される。かかる組成物溶液を基板上に均一に塗布し必要な温度で必要な時間加熱することにより、プライマー層は形成される。

【0089】プライマー層の厚さは被膜層にして0.5~50g/m²が好ましく、より好ましくは1~10g/m²である。厚さが0.5g/m²よりもうすいと基板表面の形態欠陥および化学的悪影響の遮断効果があり、50g/m²よりも厚いと経済的見地から不利となるので上記の範囲が好ましい。

【0090】最上層のシリコーンゴム層としては、従来の水なし平版のシリコーン組成物が全て使用できる。

【0091】 このようなシリコーンゴム層は線状オルガノポリシロキサン (好ましくはジメチルポリシロキサ

14

ン)をまばらに架橋することにより得られるものであり、代表的なシリコーンゴム層は、次式(I)に示されるような繰り返し単位を有するものである。

[0092]

【化1】

$$\frac{-\left(\begin{array}{c} R \\ \vdots \\ R \end{array}\right) - O \xrightarrow{\prod_{i=1}^{R}} O \left(1\right)$$

10 (ここでnは2以上の整数である。Rは炭素数1~10 のアルキル、アリール、あるいはシアノアルキル基である。全体のRの40%以下がビニル、フェニル、ハロゲン化ビニル、ハロゲン化フェニルであり、Rの60%以上がメチル基であるものが好ましい。また鎖末端もしくは側鎖の形で分子鎖中に少なくとも一つ以上の水酸基を有する。)

本発明の印刷版に適用するシリコーンゴム層の場合には次に示すような縮合型の架橋を行うシリコーンゴム(RTV、LTVシリコーンゴム)を用いることができる。このようなシリコーンゴムとしてはオルガノボリシロキサン鎖のRの一部がHに置換されたものが使用できるが、通常(II)と(III)、(IV)で表される末端基どうしの縮合によって架橋される。これにさらに過剰の架橋剤を存在させる場合もある。

[0093]

【化2】

1 /b

30

[化3]
$$\begin{pmatrix} R_1 \\ C=N-O \end{pmatrix} - \stackrel{R}{\text{Si}} - O \longrightarrow \quad \text{(III)}$$

【化4】

$$\left(\begin{array}{ccc} & R & \\ I & \\ -Si - O & \\ 2 & \end{array}\right) (IV)$$

4

(ここでRは式(I)で説明したRと同様であり、 R1、R2は1個の低級アルキル基であり、Acはアセチ ル基である。)

このような縮合型の架橋を行うシリコーンゴムには、スズ、亜鉛、鉛、カルシウム、マンガンなどの金属カルボン酸塩、例えばラウリン酸ジブチルスズ、スズ(II)オクトエート、ナフテン酸塩など、あるいは塩化白金酸のような触媒が添加される。

【0094】これらの組成物の他に、アルケニルトリア 50 ルコキシシランなどの公知の接着性付与剤を添加するこ

とや、総合型シリコーンゴム層の組成物である水酸基含 有オルガノポリシロキサン、加水分解性官能基含有シラ ン(もしくはシロキサン)を添加することも任意であ り、またゴム強度を向上させる目的で、シリカなどの公 知充填剤を添加することも任意である。

【0095】さらに、本発明においては、上述の縮合型 シリコーンゴムの他に、付加型のシリコーンゴムを用い\* \* ることも可能である。

【0096】付加型のシリコーンゴムとしては、下記に 示すようにSi-H結合を有するハイドロジェンポリシ ロキサンとCH=CH結合を有するビニルポリシロキサ ンを白金系の触媒で架橋硬化させたものが好ましく用い られる。

16

[0097]

(1) 1分子中にケイ素原子に直接結合したアルケニル基(好ましくはビニル

基)を少なくとも2個有するオルガノポリシロキサン 100重量部

(2) 1分子中に少なくともSiH基を2個有するオルガノハイドロジェンポ

リシロキサン

(3)付加触媒

成分(1)のアルケニル基は分子鎖末端、中間のいずれ にあっても良く、アルケニル基以外の有機基としては置 換もしくは非置換のアルキル基、アリール基である。成 分(1)は水酸基を微量有していてもよい。成分(2) は成分(1)と反応してシリコーンゴム層を形成する が、感熱層に対する接着性の付与の役割を果たす。成分 (2)の水素基は分子鎖末端、中間のいずれにあっても のから選ばれる。成分(1)と成分(2)の有機基はイ ンキ反発性の向上の点で総じて基数の60%以上がメチ ル基であることが好ましい。成分(1)および(2)の 分子構造は直鎖状、環状、分枝状のいずれでもよく、ど ちらか少なくとも一方の分子量が1000を超えること がゴム物性の面で好ましく、さらに成分(2)の分子量 が1000を超えることが好ましい。成分(1)として は、α、ωージビニルポリジメチルシロキサン、両末端 メチル基の (メチルビニルシロキサン) (ジメチルシロ キサン)共重合体などが例示され、成分(2)として は、両末端水素基のポリジメチルシロキサン、α、ωー ジメチルポリメチルハイドロジェンシロキサン、両末端 メチル基の(メチルハイドロジェンシロキサン)(ジメ チルシロキサン) 共重合体、環状ポリメチルハイドロジ ェンシロキサンなどが例示される。成分(3)の付加触 媒は、公知のもののなかから任意に選ばれるが、特に白 金系の化合物が好ましく、白金単体、塩化白金、塩化白 金酸、オレフィン配位白金などが例示される。これらの 組成物の硬化速度を制御する目的で、テトラシクロ(メ チルビニル)シロキサンなどのビニル基含有のオルガノ 40 刷版を形成することも可能である。 ポリシロキサン、炭素-炭素三重結合含有のアルコー ル、アセトン、メチルエチルケトン、メタノール、エタ ノール、プロピレングリコールモノメチルエーテルなど の架橋抑制剤を添加することも可能である。これらの組 成物は、3成分を混合した時点において付加反応が起 き、硬化が始まるが、硬化速度は反応温度が高くなるに 従い急激に大きくなる特徴を有する。故に組成物のゴム 化までのポットライフを長くし、かつ感熱層上での硬化 時間を短くする目的で、組成物の硬化条件は、基板、感

0.1~1000重量部 0.00001~10重量部

※硬化するまで高温に保持しておくことが、感熱層との接

着力の安定性の面で好ましい。

【0098】これらの組成物の他に、感熱層との接着性 を向上させる目的で前述の公知のシランカップリング剤 を添加することも有効である。

【0099】これ以外にも、縮合型シリコーンゴム層の 組成物である水酸基含有オルガノポリシロキサン、加水 よく、水素以外の有機基としては成分(1)と同様のも 20 分解性官能基含有シラン(もしくはシロキサン)を添加 することも任意であり、またゴム強度を向上させる目的 で、シリカなどの公知の充填剤を添加させることも任意

> 【0100】これら、シリコーンゴム層の膜厚は0.5 ~50g/m²が好ましく、さらに好ましくは0.5~ 10g/m²である。膜厚が0.5g/m²よりも小さい 場合には、印刷版のインキ反発性が低下しやすく、50 g/m²よりも大きい場合には、経済的見地から不利で ある。

【0101】以上説明されたように構成された水なし平 30 阪印刷版原版の表面のシリコーンゴム層を保護するなど の目的で、シリコーンゴム層の表面にプレーンまたは凹 凸処理した薄い保護フィルムをラミネートしたり、特開 平5-323588号公報に記載の現像溶媒に溶解する ような、ポリマー塗膜を形成することも可能である。

【0102】特に、保護フィルムをラミネートした場合 には、保護フィルム上からレーザー露光を行い、その後 保護フィルムを剥離することによって印刷版上にパター ンを形成する、いわゆる剥離現像を行うことによって印

【0103】本発明における水なし平版印刷版の製造方 法について説明する。基板上にリバースロールコータ ー、エアーナイフコーター、メーヤバーコーターなどの 通常コーターあるいはホエラーのような回転塗布装置を 用い、必要に応じてプライマー層組成物を100~30 ○℃で数分間熱硬化した後、感熱層組成物塗液を塗布、 50~180℃で数分間熱硬化、または光硬化し、シリ コーンゴム層組成物塗液を塗布、50~200℃の温度 で数分間処理してゴム硬化させて形成する。その後、必 熱層の特性が変わらない範囲の温度条件で、かつ完全に※50 要に応じて保護フィルムをラミネートするか、あるいは

保護層を形成する。

【0104】その後必要に応じ、版を加熱したり、光照 射し感熱層の硬化および感熱層とシリコーンゴム層の接 着力を向上させる。

【0105】このようにして得られた直描型水なし平版 印刷販原版を、保護フィルムを剥離してから、または保 護フィルム上からレーザー光で画像上に露光する。

【0106】露光には通常レーザー光が使用されるが、この時の光源としては発信波長が300nm~1500nmの範囲にあるArイオンレーザー、Krイオンレーザー、He-Neレーザー、He-Cdレーザー、ルビーレーザー、ガラスレーザー、半導体レーザー、YAGレーザー、チタンサファイアレーザー、色素レーザー、窒素レーザー、金属蒸気レーザーなどの種種のレーザーが使用できる。なかでも半導体レーザーは、近年の技術的進歩により、小型化し、経済的にも他のレーザー光源よりも有利であるので好ましい。

【0107】上記の方法で露光された直描型水なし平版 印刷版は、必要に応じて剥離現像、または通常の溶剤現 像処理される。

【0108】本発明で用いられる現像液としては、例えば水や、水に下記の極性溶媒を添加したものや、脂肪族炭化水素類(ヘキサン、ヘプタン、「アイソパーE、G、H」(エクソン化学製イソパラフィン系炭化水素の商品名)、ガソリン、灯油など)、芳香族炭化水素類(トルエン、キシレンなど)、ハロゲン化炭化水素類(トリクレンなど)など少なくとも1種類以上の混合溶媒に下記の極性溶媒を少なくとも1種類添加したものが

好ましく用いられる。

【0109】アルコール類(メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、プロピレングリコール、シプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、1、3ーブチレングリコール、2、3ーブチレングリコール、ヘキシレングリコール、3ーメチル1、3ーブタンジオール、2ーエチルー1、3ーヘキサンジオールなど)

エーテル類 (エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレン 40 グリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノへキシルエーテル、ジエチレングリコールー 2 ーエチルへキシルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、テトラエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピ\*

\*レングリコールモノメチルエーテル、モノグライム、ジ グライム、トリグライム、テトラグライム、ジオキサ ン、テトラヒドロフランなど)

エステル類(酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチル、エチレングリコールモノメチル エーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチル エーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチル エーテルアセテートなど)

この時の光源としては発信波長が300 n m~1500 カルボン酸(2-エチル酪酸、カプロン酸、カプリル n mの範囲にあるAェイオンレーザー、Kェイオンレー 10 酸、2-エチルヘキサン酸、カプリン酸、オレイン酸、ザー、He-Neレーザー、He-Cdレーザー、ルビ ラウリル酸など)。

【0110】また上記の現像液組成には、公知の界面活性剤を添加することも自由に行われる。また、さらにアルカリ剤、例えば炭酸ナトリウム、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジグリコールアミン、モノグリコールアミン、トリエタノールアミン、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、水酸化カリウム、ホウ酸ナトリウムなどを添加することもできる。

【0111】また、これらの現像液にはクリスタルバイ 20 オレット、ピクトリアピュアブルー、アストラゾンレッ ドなど公知の塩基性染料、酸性染料、油溶性染料を添加 して、現像と同時に画像部の染色化を行い検販性の向上 をはかることができる。

【0112】現像する際には、これらの現像液を不織布、脱脂綿、布、スポンジなどに含浸させて版面を拭き取ることによって、現像することができる。

【0113】また、現像には 特開昭63-16335 7に記載されているような自動現像記を用い、上記の現 像液で版面を処理した後に水道水などでシャワーしなが 30 ら回転ブラシで版面を擦ることによって、好適に現像す ることができる。

【0114】上記の現像液に代えて、温水や水蒸気を販面に噴射することによっても現像が可能である。

【0115】得られた刷版は、版面の保護などから紙、 各種プラスチックフィルムをラミネートしたり、版面保 護コーティングを行ってもよい。

[0116]

【実施例】以下実施例によって本発明をさらに詳しく説 明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0117】実施例1

厚さ0.15mmの脱脂したアルミ板上に下記の組成からなるプライマー液をバーコーターを用いて塗布し、180℃で2分間乾燥し、膜厚4g/m²のプライマー層を塗布した。

[0118]

プライマー層組成

(a) ポリウレタン樹脂 (サンプレンLQ-T1331、三洋化成工業 (株) 製)

20

(b) ブロックドイシシアネート (タケネートB830、武田薬品(株)製)

35重量部

(c) エポキシ・フェノール・尿素樹脂 (SJ9372、関西ペイント (株) 製

8重量部

(d) ジメチルホルムアミド。

900重量部

**続いてこの上に下記の感熱層組成物をバーコーターを用** \*感熱層を設けた。 いて塗布し、90℃で3分間乾燥し、膜厚1g/m²の\*

#### 感熱層組成

(a)カーボンブラック分散アクリル樹脂

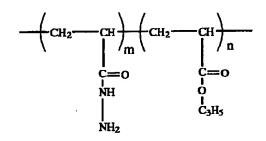
30重量部

(内カーボンブラック15重量部)

(b) ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂

50重量部

【化5】



(MW = 50000 m: n = 30:70)

(c) デナコールEX512 (ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ナガ

セ化成工業(株)製)

5重量部

(d) テトラヒドロフラン

200重量部

(e) ジメチルホルムアミド (f)メチルイソブチルケトン 500重量部 200重量部

続いてこの上に下記の組成を有するシリコーンゴム層組 ※一ンゴム層を設けた。

成物をバーコーターを用いて塗布し、露点30℃、12 30 【0119】

5℃で2分間湿熱硬化乾燥し、膜厚2g/m²のシリコ ※

シリコーンゴム層組成

(a) ポリジメチルシロキサン (分子量約25,000、末端水酸基)

100重量部

(b) ピニルトリ (メチルエチルケトオキシム) シラン

10重量部

(c) "アイソパーE" (エクソン化学(株)製)

900重量部

上記のようにして得られた積層板に、厚さ8µmのポリ エステルフィルム"ルミラー"(東レ(株)製)をカレ ンダーローラーを用いてラミネートし、直描型水なし平 版印刷版原版を得た。

【0120】この後、この印刷版原版の"ルミラー"を 剥離し、X-Yテーブルに装着した半導体レーザー(O PC-A001-mmm-FC、出力0.75W、波長 780 nm, OPTO POWER CORPORAT ION製)を用いて、ビーム直径20μm、露光時間1 Oµsで、パルス露光を行った。この際、レーザーの出★

★力を、(a) 350mW、(b) 300mW、(c) 2 50mW、(d) 200mW、(e) 150mWに変化 させ露光した。

40 【0121】続いて上記露光済みの版を、TWL-11 60 (東レ(株)製、水なし平版印刷版の現像機)を用 いて60cm/minの速度で現像を行った。ここで前 処理液としては、液温は40℃で以下の組成を有する液 を用いた。

[0122]

(a) ポリプロピレングリコール (分子量200)

95重量部

(b)水

5重量部

また、現像液としては水を用い液温は25℃とした。染 ☆5℃とした。 色液としては、以下の組成を有する液を用い、液温は2☆50 【0123】

(a) C. I. Basic Blue 1染料

(b) ブチルカルビトール

(c) 2-エチルヘキシル硫酸ナトリウム

(d)シリコーン系消泡剤

(e)水

この現像後の版の評価は、50倍のルーペで、画線部の

感熱層表面状態と画線部/非画線部の境界の状態を観察

22

0.2重量部

5 重量部

0.3重量部

0.0005重量部

95重量部

\* 同様に示される。

【0126】比較例1

実施例1の感熱層組成中の(b)樹脂をヒドラゾ基を含 有しない以下の樹脂に変更した以外は実施例1と同様に 10 版を作製し評価した。

[0127]

【化6】

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2 & CH_2 & CH_2 \\
\hline
C=0 & C=0 \\
OH & O \\
C_3H_5
\end{array}$$

(MW = 50000 m : n = 30:70)

し、境界がシャープで画線部のシリコーンゴム層がフリ ンジがなく剥離できている場合を〇、境界がノコギリ刃 状でシリコーンゴムのフリンジの見られる場合を△と し、シリコーンゴム層が剥離されていない場合は×とし

【0124】次にハンドローラーで水なし平版用インキ (Waterless S、ザ・インテック(株)製、 赤)を、版面全面に展開して、感度を調べた。

【0125】露光条件(a)~(e)の版面を観察し、 均一にインキが画線部に着肉している場合を○、不均一 にインキが画線部に着肉している場合を△、全くインキ が画線部に着肉しない、もしくはシリコーンゴム層が剥 離できていない場合を×とした。尚、ここで言う版の感 20 度とは、露光条件(a)~(e)に変更したなかで、レ ーザーの出力が小さい条件でもシリコーンゴム層が剥離 されインキが均一に着肉するものが感度が高いことを示 し、そのエネルギー値で表す。結果を表1に示す。な お、以下の実施例2~10および比較例1~5の結果も\*

(a) カーボンブラック

(b) ニトロセルロース

(c) エポキシ樹脂

(d) メラミン樹脂

比較例2において、感熱層中のニトロセルロース、エポ

キシ樹脂およびメラミン樹脂の配合量を以下の組成に変※

(a) カーボンブラック

(b) ニトロセルロース

(e) ジメチルホルムアミド

(f)メチルイソブチルケトン

(c) エポキシ樹脂

(d) メラミン樹脂

(e) ジメチルホルムアミド

(f)メチルイソブチルケトン

#### 比較例2

実施例1において、感熱層組成を以下のものに変更した 以外は全て同様に版材を作製し評価した。

[0128]

15重量部

36重量部

25重量部

24重量部

100重量部

800重量部

※更した以外は全て同様に版材を作製し評価した。

[0129]

15重量部

56重量部

15重量部

14重量部

100重量部

800重量部

★更した以外は全て同様に版材を作製し評価した。

[0130]

比較例4

比較例3

比較例2において、感熱層中のニトロセルロース、エポ キシ樹脂およびメラミン樹脂の配合量を以下の組成に変★

(a) カーボンブラック

(b) ニトロセルロース

(c) エポキシ樹脂

(d)メラミン樹脂

(e) ジメチルホルムアミド

(f) メチルイソブチルケトン

15重量部

16重量部

35重量部

34重量部

100重量部

800重量部

実施例2

☆50☆実施例1のプライマー層上に下記の感熱層組成物をバー

2.4

コーターを用いて塗布し、90℃で3分間乾燥し、膜厚\* \*1g/m²の感熱層を設けた。

#### **感熱層組成**

(a)カーボンブラック分散アクリル樹脂

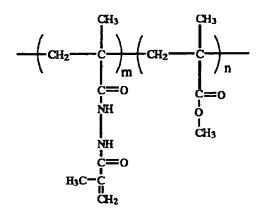
30重量部

(内カーボンブラック15重量部)

(b) ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂

50重量部

【化7】



(MW = 40000 m: n = 20:80)

(c) デナコールEX512 (ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ナガ

セ化成工業(株)製)

10重量部

(d) テトラヒドロフラン

200重量部

(e) ジメチルホルムアミド

500重量部

(f)メチルイソブチルケトン

200重量部

続いてこの上に下記の組成を有するシリコーンゴム層組

※硬化し、膜厚2g/m²のシリコーンゴム層を設けた。

成物をバーコーターを用いて塗布し、125℃で2分間※ 【0131】

シリコーンゴム層組成

(a) ビニル基含有ポリシロキサン (末端水酸基)

90重量部

(b) ハイドロジェンポリシロキサン

8重量部

(c)重合禁止剤

2重量部

2 3E.4E.HP

(d)触媒

5重量部

(e) "アイソパーE" (エクソン化学(株)製)。

900重量部

上記のようにして得られた積層板に、厚さ8μmのポリエステルフィルム"ルミラー"(東レ(株)製)をカレンダーローラーを用いてラミネートし、直描型水なし平版印刷版原版を得た。現像および評価は実施例1と同様に行った。

★実施例2の感熱組成中の(b)樹脂をヒドラゾ基を有さないアクリル系樹脂に変更した以外は実施例2と同様に 版を作成し、評価した。

【0133】 【化8】

【0132】比較例5

\*

(MW = 50000 m: n = 20:80)

## 実施例3

\*に版を作製し、評価した。

実施例2の感熱層組成中のヒドラゾ基を有するアクリル

[0134]

系樹脂を以下の樹脂にに変更した以外は実施例2と同様\*20 【化9】

(MW = 22000 m: n = 35:75)

## 実施例4

※同様に版を作製し評価した。

実施例1の感熱組成中の(b)のヒドラゾ基を有するア 40 【0135】 クリル系樹脂を以下の樹脂に変更した以外は実施例1と※ 【化10】

$$\begin{array}{c}
27 & 0 & 0 \\
- \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{NH} - \text{NH} - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_2 \\
\text{CH}$$

(MW = 20000 m : n = 15 : 85)

実施例5

\*80℃で2分間乾燥し、膜厚4g/m²のプライマー層

厚さ0.15mmの脱脂したアルミ板上に下記の組成か

を塗布した。

らなるプライマー液をバーコーターを用いて塗布し、1\*

\* [0136]

プライマー層組成

(a)ポリウレタン樹脂(サンプレンLQ-T1331、三洋化成工業(株)製)

90重量部

(b) ブロックドイシシアネート (タケネートB830、武田薬品 (株) 製)

35重量部

(c) エポキシ・フェノール・尿素樹脂 (SJ9372、関西ペイント (株) 製)

8重量部

(d)酸化チタン

10重量部

(e) ジメチルホルムアミド。

900重量部

続いてこの上に下記の感熱層組成物をバーコーターを用 ※感熱層を設けた。 いて塗布し、90℃で3分間乾燥し、膜厚1g/m²の※

## 感熱層組成

(a) 赤外線吸収色素 (KAYASORB IR-820(B)、日本化薬 (株

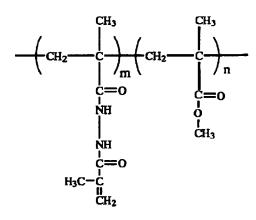
) 製)

10重量部

(b) ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂

85重量部

## 【化11】



(MW = 40000 m: n = 20:80)

(c) デナコールEX512 (ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ナガ

セ化成工業 (株) 製)

5重量部

(d) テトラヒドロフラン

200重量部

(e) ジメチルホルムアミド

500重量部

(f)メチルイソブチルケトン

200重量部

30

**続いてこの上に下記の組成を有するシリコーンゴム層組** \*硬化し、膜厚2g/m²のシリコーンゴム層を設けた。 成物をバーコーターを用いて塗布し、125℃で2分間\* 【0137】

シリコーンゴム層組成

(a) ビニル基含有ポリシロキサン (末端水酸基) 90重量部 (b) ハイドロジェンポリシロキサン 8重量部 (c) 重合禁止剤 2重量部 (d)触媒 5重量部

(e) "アイソパーE" (エクソン化学(株)製)。

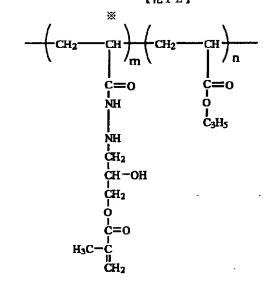
900重量部

上記のようにして得られた積層板に、厚さ8μmのポリ カレンダーローラーを用いてラミネートし、直描型水な し平版印刷版原版を得た。現像および評価は実施例1と 同様に行った。

※実施例5の感熱組成中の(b)樹脂を以下のヒドラゾ基 プロピレンフィルム"トレファン"(東レ(株)製)を 10 を有するアクリル系樹脂に変更した以外は実施例5と同 様に版を作製し評価した。

> [0139] 【化12】

【0138】実施例6



(MW = 22000 m : n = 35 : 75)

実施例7

★同様に版を作製し評価した。

実施例5の感熱組成を以下に変更した以外は実施例5と★

[0140]

感熱層組成

(a) 赤外線吸収色素 (KAYASORB IR-820(B)、日本化薬 (株

10重量部

(b) ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂

60重量部

【化13】

31

$$\begin{array}{c|c} -CH & CH_2 & CH \\ \hline & & & \\ &$$

(MW = 22000 m: n = 35:75)

(c)ポリウレタン (サンプレン IB-465、固形分30%、三洋化成(株)

83重量部

(d) デナコールEX512 (ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ナガ

セ化成工業(株)製)

5重量部

(e) テトラヒドロフラン

200重量部

(f) ジメチルホルムアミド

500重量部

(g) メチルイソブチルケトン

200重量部

実施例8 実施例7の感熱組成を以下に変更した以外は実施例7と\*

\* 同様に版を作成し評価した。

[0141]

## 感熱層組成

(a) 赤外線吸収色素 (KAYASORB IR-820(B)、日本化薬 (株

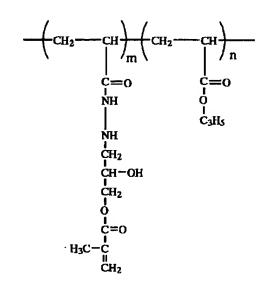
) 製)

10重量部

(b) ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂

35重量部

## 【化14】



(MW = 22000 m: n = 35:75)

34

(c) ポリウレタン (サンプレン IB-465、固形分30%、三洋化成(株)

载)

170重量部

(d) デナコールEX512 (ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ナガ

セ化成工業(株)製)

5重量部

(e) テトラヒドロフラン

200重量部

(f) ジメチルホルムアミド

500重量部

(g)メチルイソブチルケトン

200重量部

実施例9

\*同様に版を作成し評価した。

実施例7の感熱組成を以下に変更した以外は実施例7と\*

[0142]

感熱層組成

(a) 赤外線吸収色素 (KAYASORB IR-820(B)、日本化薬 (株

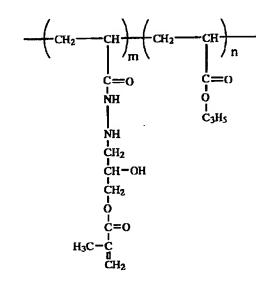
) 魍

10重量部

(b) ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂

15重量部

## 【化15】



 $(MW = 2 \ 2 \ 0 \ 0 \ m : n = 3 \ 5 : 7 \ 5)$ 

(c) ポリウレタン (サンプレン I B-465、固形分30%、三洋化成(株) 製) 233 重量部

(d)デナコールEX512(ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ナガ

セ化成工業 (株) 製) (e) テトラヒドロフラン 5 重量部

200重量部 500重量部

(f)ジメチルホルムアミド (g)メチルイソブチルケトン

200重量部

実施例10

40%同様に版を作製し評価した。

実施例5の感熱組成を以下に変更した以外は実施例5と※

[0143]

## 感熱層組成

(a) 赤外線吸収色素 (KAYASORB IR-820(B)、日本化薬 (株

) 製)

10重量部

(b) ヒドラゾ基を有するアクリル系樹脂

40重量部

## 【化16】

35  $\begin{array}{c}
CH_{3} & CH_{3} & CH_{3} \\
CH_{2} & CH_{2} & CH_{2} & CH_{2} & CH_{2}
\end{array}$   $\begin{array}{c}
CH_{3} & CH_{3} & CH_{2} & CH_{2} \\
CH_{2} & CH_{2} & CH_{2}
\end{array}$   $\begin{array}{c}
CH_{2} & CH_{2} & CH_{2}
\end{array}$   $\begin{array}{c}
CH_{3} & CH_{2} & CH_{2}
\end{array}$ 

(MW = 40000 m:n:l=10:10:80)

(c)ポリウレタン (サンプレン IB-465、固形分30%、三洋化成(株)

製)

150重量部

(d) デナコールEX512 (ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ナガ

セ化成工業 (株) 製)

5重量部

(e)テトラヒドロフラン

40重量部

(f) ジメチルホルムアミド

40重量部

(g)メチルイソプチルケトン

20重量部

以上の結果より感熱層を構成する化合物の分子内にヒドラゾ基を有する化合物を含む版は、ニトロセルロースを 含有する版と比較し、画線部/非画線部のエッジがシャ\*

\*ープで、しかも感度が高い。

[0144]

【表1】

| ## ( m m )                              |                |
|---|----------------|
| 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                |
|   | 計劃(開)          |
|   | カードップ・テック なし   |
|   | カーボンフ・ラック      |
|   | 1-4" >7" 7" 7" |
| 0 | カーボンブラック なし    |
|   | おりが発達 なし       |
| 0 0 0 0 × × × × × × 0 0 0 0 0 × × × × × | おり が が を な し   |
|   | ポーリメチン系位置 なし   |
| O O X X X X X X O O X X X X X X X X X X | ポリメチが職 なし      |
| O x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | おりが経験 なし       |
| x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   | ギザが雑 ない        |
| x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   | カーボンブラック なし    |
| x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   | カーキ・ソフ・ラック あり  |
| x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   | カーキ・ソブ・ラック あり  |
| x x x x x x x x                         | カーキ・ソフ・ラック あり  |
|   | ホ・リメチン系色素 な    |

[0145]

【発明の効果】本発明は、感熱層を構成する化合物の分 子内にヒドラゾ基を有する化合物を含有させることによ\*40

\*り、画線部/非画線部のエッジがシャープになる。さらに高感度の直描型水なし平版印刷版が得られる。